

Porta Wafer Personalizzato In Ptfе Resistente Alla Corrosione Per Lavorazione Del Polisilicio Semiconduttore Ad Alta Temperatura

Numero articolo: PL-CP287



introduzione

Supporti per wafer in PTFE personalizzati di alta qualità progettati per ambienti chimici estremi e lavorazione semiconduttrice ad alta temperatura. Questi portelli resistenti alla corrosione garantiscono una manipolazione ad alta purezza, un funzionamento a basso attrito e un'eccezionale durata per i processi critici di produzione di polisilicio, fotovoltaico e elettronica avanzata.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Incisione wafer di silicio	Mantenimento sicuro dei wafer di silicio durante l'immersione in miscele aggressive di acido fluoridrico e nitrico.	Eccezionale resistenza agli acidi e zero contaminazione.
Processo di pulizia RCA	Utilizzato come portone in sequenze di pulizia multistep che coinvolgono ammoniaca e perossido di idrogeno.	Resiste alla degradazione da parte di forti agenti ossidanti.
Produzione di celle solari	Supporto dei substrati fotovoltaici durante i processi di drogaggio e texturizzazione superficiale nel settore solare.	Elevata stabilità termica e inerzia chimica.
Manipolazione lingotti di polisilicio	Gestione del posizionamento di pezzi di polisilicio ad alta purezza durante la purificazione e l'analisi.	Previene la lisciviazione di ioni metallici e danni da contatto superficiale.
Strumentazione per analisi delle tracce	Funge da rack specializzato per lo stoccaggio e il trasporto di campioni ad alta purezza in chimica analitica.	Garantisce il massimo livello di integrità e purezza del campione.
Banco umido per semiconduttori	Integrazione in sistemi automatici di lavorazione a umido per la pulizia e il risciacquo di substrati ad alto volume.	Il basso attrito facilita una manipolazione automatica fluida.
Fissaggi per galvanica	Agisce come supporto non conduttivo e resistente chimicamente durante i processi di elettrodeposizione di precisione.	Isolamento elettrico combinato con stabilità chimica.

Parametro	Dettaglio specifica
Identificazione prodotto	PL-CP287
Materiale di base	Politetrafluoroetilene (PTFE) ad alta purezza
Processo di produzione	Lavorazione di precisione CNC / Fabbricazione personalizzata
Disponibilità personalizzazione	Completamente su misura per le specifiche dell'utente
Intervallo di temperatura	-200°C a +260°C
Compatibilità chimica	Universale (inerte alla maggior parte di acidi, basi e solventi)
Finitura superficiale	Alta levigatura, antiaderente, idrofobo
Configurazione fessure	Larghezza, profondità e passo personalizzabili

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Parametro	Dettaglio specifica	
Capacità di carico	Adattata alla densità e alla quantità di substrati	
Controllo contaminazione	Costruzione senza metalli e senza additivi	
Dimensioni	Progettate su misura secondo le richieste del cliente	